JP-A-62 (1987) -123071

- 43. Date for publishing unexamined application: June 4, 1987
- 54. Title of the Invention: Aluminum nitride sintered body having excellent water resistance
- 5 21. Patent Application No. 60(1985)-259879
 - 22. Filing Date: November 21, 1985
 - 72. Inventor: HAGIWARA Yoichi, 9-4-6, 353-1 Shigehisa, Okubushi.
 - 72. Inventor: MIYAHARA Kenichiro, 2-15-14 Hirose, Kokubushi.
- 10 71. Applicant: Kyosera Co., Ltd. 5-22 Higashinokita Inouecho, Yamashinaku, Kyotoshi.
 - 74. Attorney: MURATA Yukio

Specification

- 1. Title of the Invention
- 15 Aluminum nitride sintered body having excellent water resistance
 - 2. Claim
- 1. An aluminum nitride sintered body having excellent water resistance comprising an oxide layer formed on the surface thereof wherein the oxide layer comprises an α -Al₂O₃ main phase having a thickness of 1 to 50 μ m formed by oxidation sintering of an aluminum nitride sintered article.

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 123071

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)6月4日

C 04 B 35/58

104

7158-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

耐水性の優れた窒化アルミニウム質焼結体 49発明の名称

> 20特 願 昭60-259879

29出 願 昭60(1985)11月21日

洋 一 国分市重久353の1 重久団地9の4の6 79発 明 者 萩 原

②発 明 者 宮原 健 一 郎 国分市広瀬2の15の14

京都市山科区東野北井ノ上町5番地の22 ⑪出 願 人 京セラ株式会社

弁理士 村田 幸雄 邳代 理 人

阴 細

1 発明の名称

耐水性の優れた窒化アルミニウム質焼精体

2 特許請求の範囲

窒化アルミニウム質焼精体の酸化焼成により生 成された厚さ1~50μmのα-Α!20,を主相と する酸化物層が表面に形成されてなることを特徴 とする耐水性の優れた窒化アルミニウム質焼結体。

3 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は高温・高強度材料、半導体パッケージ 悲板材料等として有用な、耐水性の優れた窒化ア ルミニウム質焼結体に関する。

(従来の技術)

盗化アルミニウム質セラミックスは、炭化珪素、 登化珪素などとともに優良な高温・高強度材料と して使用されている。

また、その理論熱伝導率が約300W/m* K と非常に高いものであることから高熱伝導材料と して主に半導体装置用に、そしてまた透光性の良 いものは、特色ある波艮領域をもつ透光材料とし て注目されている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、筵化アルミニウム質焼精体表面 は、下記反応式に示すごとく、水と反応して侵食 され易く、耐水性が不良である。

 $2AIN + 8H_{2}O \rightarrow AI_{2}O_{3} \cdot 3H_{2}O + 2NH_{4}(OH)$ あるいは

 $2 \land 1 \land N + 6 H_{2} \circlearrowleft \rightarrow A \downarrow_{2} \circlearrowleft \rightarrow H_{2} \circlearrowleft + 2 \land H_{3} \circlearrowleft (\circlearrowleft H)$

- 上記式による反応生成相は環境条件によって異 なるが、ギブサイト、ベーマイト、ダイアスポア 等のアルミニウム水酸化物の薄層となる。

そして上記反応中、侵食された部分の簡圓の水 は、反応により生成した水酸化アンモニウムによっ てpHが上昇し、溶解度を高めるため、上記一部 生成物も更に溶解され、一定程度まで反応を促進

させることとなる.

以上の反応のため、ファインパターンで実装された半導体装置等の電子部品が含水雰囲気中に置かれた場合、溶出した A 1、(O H)イオン等によってリード線、コンデンサ等を汚染したり、絶縁不良を招いたりして、電子部品の機能を著しく劣化させる危険がある。

そのため、実用上の障害となり、用途範囲が制限 されている。

(問題点を解決するための手段)

本発明者は前記現状に鑑み種々研究の末、窒化 アルミニウム質焼結体の耐水性を向上させること に成功した。

すなわち、窒化アルミニウム質焼結体の表面を高温酸化処理して、酸化物の保護層を形成すると 該焼結体の耐水性が著しく向上することを知見し 本発明をなすに至ったのである。

したがって本発明は、窒化アルミニウム質焼結 休の酸化焼成により生成された厚さ1~50μm のα-Λ1,0,を主相とする酸化物層が表面に形

A 12 O 3 層を形成させた。高温下では主に以下の 反応が容易に進行する。

4 A I N + 3 O 2→ 2 A I 2 O 2 + 2 N 2 しかし、この高温酸化処理において酸化物層が 1 μmより薄い場合は、保護圏としての効力を発揮 せず、耐水性の優れた窒化アルミニウムとはならない。

他方、50μmを越える酸化物層を形成した場合は、αーΛ1.0m層と基体の窒化アルミニウム焼 結体材料との間の無筋張率差によると考えられる、 クラックが発生する。そしてこれは、前記高温酸 化処理時のみならず、製品が高温において、繰り 返し、熱履騰を受ける環境にさらされると、強度 劣化を生じる。クラックを生じたものは、クラック を通して酸化が急激に促進されることとなる。

したがって以上のように、酸化物層の厚みを 1 μ = ~ 5 0 μ = とすることによつて、表面の耐水性 を向上させ、かつ、強度劣化を起こさない、窒化 アルミニウム統結体が得られるのである。

(実施例)

成されてなることを特敬とする耐水性の優れた窒 化アルミニウム質焼結体にある。

上記木発明の窒化アルミニウム質焼結体を製造するには、所定形状の窒化アルミニウム質焼結体を製造を酸化雰囲気中で高温処理した後、冷却すればよいのであるが、高温酸化処理した後に行う冷しが出し、酸化物層が比較的厚い場合は、徐冷ししまい、耐水性の向上が望めない。

高温酸化焼成は通常1000℃以上で行うことが好ましく、酸化物圏の厚みを10μm程度とする場合は1300℃付近で1時間、20μm程度とする場合には1400℃付近で1時間、実施すればよい。

上記のごとく、表面処理を行わない窒化アルミニウム質焼結体は水に侵され易く耐水性が不良でありことから、本発明では上記反応から焼結体を保護するための手段として、窒化アルミニウム質焼結体表面部分に高温酸化処理による安定なαー

塩化アルミニウム粉末95重量%に、焼結助剂として酸化イットリウム5重量%を添加、混合し、さらにバインダーとしてパラフィンワックス6重量%とステアリン酸1重量%を加えて混合したものを、成形圧1000Ks/cm²でプレス成形して所定形状体となし、これら多数個製作した。

次ぎに上記製作された成形体を常法により限順 した後、登業芽囲気中、1850℃、30分間で常 圧焼成して登化アルミニウム質焼結体を得た。

そしてその気結体の表面をダイアモンドホイールで研究し、ダイアモンドバットにより平面となし、30mm×1mmの板状試料となした後、空気中、750~1600で、各1時間保持する加熱スケジュールで酸化塩の表面層をX級解析に酸化層を形成させた。酸化塩の表面層をX級解析により分析した結果、生成物は主相がαー AliO であり、他に AINの 焼結助剤に 起因する Cuー AI-O 系 相や Y - AI-O 系相が 微量 存在していることを確認した。酸化物 量から 算出された 連の厚さは第1 図に示すように、プロットされた。

1 μ m以下では酸化増量が微量で測定不能、5 0 μ m より厚い酸化層ではクラックが生じた。

代表的な試料として、未処理試料、800℃処理の微少酸化試料、0.5μm、1μm、5μm、10μm及び40μmの酸化層をもつ試料を作成し、プレッシャークッカー法(120℃、2気圧)で耐水性テスト、その他を行った。その結果は第1表及び第2図に示すごときものであり、水酸化物生成による増量が見られなくなるのは、この処理方法でも1μm以上の酸化物層が形成されたものであることが判る。

なお、形成される酸化物層の厚み (d) と高温酸化処理時間 (t) との関係については、略 $d^2 \propto t$ の関係が成り立つことを確認している。

第 1 表

	武科	酸化層の	24時間PCT	熟伝導率	表面状態
番号		厚み(µn	後の重量変化	W∕n° K	
			(μg/mm²)		
	• 1	0	12	120	PCT後変色
	* 2·	0.5	12	120	"
Ì	3	i	10	120	PCT後わずかに変色
	4	5	4	110	〃 変色なし
	5	10	0	103	,, ,,
	6	20	0	103	<i>u</i> ,,
	7	40	0	103	. # #
	8	50	0	91	,, ,,
	• 9	55	0	85	酸化処理後27,2発生
	*10	60	0	85	酸化処理後29-27発生

注1. PCT:プレッシャークッカー試験

注2. 熱伝導率はα-Al₂O₃層上から測定した値である。

*は本発明の範囲外

(発明の効果)

優れた高温特性、然伝導特性を有し、高温材料、 半導体装置等に大いに使用されつつある窒化アル ミニウム質焼結体が、耐水性が不良であるため実 用上の障害があってその用途範囲も限定されてい たという問題点は、以上のとおり本発明によって 十分に解決できることとなった。

そして本発明の酸化物層を形成するには酸化雰 断気中で単に高温加熱するという極めて簡単な手 段を採用すればよいという点で非常に有利なもの である。

4 図面の簡単な説明

第1 図は窒化アルミニウム質焼結体の高温酸化処理と生成された酸化物層のαーAliOi層の厚みとの関係を示すグラフ、第2 図は窒化アルミニウム質焼結体の表面αーAliOi形成層厚みとアレシャークッカー試験後の水との反応による水酸化物の増振の関係を示すグラフである。



